

今後の進め方について(案)

1. 主な検討項目

< 1 > 創造・保護・活用分野に関する課題について

・ 創造分野

- (1) 大学等における知的財産の創造
- (2) 企業における質の高い知的財産の創造

・ 保護分野

- (1) 模倣品・海賊版対策
- (2) 特許審査の迅速化
- (3) 世界特許の実現
- (4) 特許出願による技術流出の防止
- (5) デザイン・ブランドの保護強化

・ 活用分野

- (1) 国際標準化活動の強化
- (2) 中小・ベンチャー企業支援、地域における知財戦略

・ 創造・保護・活用分野の連携

< 2 > 知財人材育成のための総合戦略

< 3 > 知財の広がりに対応した国際ルールの構築

2. 今後の進め方について

専門調査会において上記の主要検討項目について検討を行い、とりまとめがなされたものについては、その内容を公表する。

3. 当面の日程と議論の進め方

11月2日(水) 13:30 - 15:30 第1回専門調査会

- ・ 検討項目の確認
- ・ 知的創造サイクルに関する課題について

11月30日(水) 10:00 - 12:00 第2回専門調査会

- ・ 知的創造サイクルに関する課題について
＜知財人材育成のための総合戦略＞

12月21日(水) 10:00 - 12:00 第3回専門調査会

- ・ 知的創造サイクルに関する課題について
＜知財の広がりに対応した国際ルールの構築＞

1月30日(月) 13:30 - 15:30 第4回専門調査会

- ・ 推進計画2003 - 2005の実施状況のレビュー
- ・ 知的創造サイクルの推進方策について

2月17日(金) 14:00 - 16:00 第5回専門調査会

- ・ これまでの議論のとりまとめ

なお、議論の進捗状況等により、上記スケジュールの変更があり得る。